

(別紙1)

三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表

(令和7年7月1日改訂)

No.	機器名	設置場所	料金(税抜)
7	乾燥炉200°C	クリーンルームB	3,000
9	予熱ラミネーター	クリーンルームB	3,200
11	クリーンローラ	クリーンルームB	2,400
12	真空ラミネータ	クリーンルームB	7,800
21	プリント基板用直接描画装置	クリーンルームB	29,800
23	乾燥炉360°C	クリーンルームB	3,000
23-2	乾燥炉	クリーンルームE	3,000
23-3	乾燥炉Si専用	クリーンルームD	3,000
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームB	6,900
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームC	4,100
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームD	5,700
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームD	8,400
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームD	3,000
46	オートマチックサーフェスグラインダー	クリーンルームD	11,500
48	オートマチックダイシングソー	クリーンルームD	7,800
49	ストレスリリーフ研磨装置	クリーンルームD	10,300
R1	高温クリーンオープン	クリーンルームD	8,500
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームE	3,600
53	ウェハーカップ式銅メッキ装置	クリーンルームE	14,300
55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉	クリーンルームE	8,300
50	リアクティブイオンエッチャー	クリーンルームF	15,700
51	絶縁膜形成装置	クリーンルームF	14,700
52	縦型酸化炉	クリーンルームF	8,200
65	電界放出型分析走査電子顕微鏡	クリーンルームF	13,300
40	微細パターン加工装置	クリーンルームG	17,300
41	スピンコーター	クリーンルームG	4,900
42	アルカリデベロッパ	クリーンルームG	5,400
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア	5,300
17	プロダクションモジュラー	実装エリア	6,000
19	大型基板対応フリップチップボンダ	実装エリア	12,200
24	鉛フリー対応N2リフロー装置	実装エリア	5,800

No.	機器名	設置場所	料金（税抜）
32	内蔵部品検査装置	実装エリア	8,700
R5	熱衝撃試験機	実装エリア	1,300
13	乾燥炉200°C	水平ライン室	3,000
27	基板用現像装置	水平ライン室	11,200
28	ソフトエッチ水洗装置	水平ライン室	9,700
29	レジスト剥離装置	水平ライン室	14,500
31	基板用ケミカルエッチング装置	水平ライン室	12,900
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室	7,500
34	積層前粗化处理装置	めっきライン室	11,700
35	デスミア装置	めっきライン室	14,200
36	基板用無電解めっき装置	めっきライン室	12,200
37	電解ビアフィルめっき装置	めっきライン室	15,500
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室	5,900
4	プリント基板穴明機	機械加工室	6,500
5	プリント基板外形加工機	機械加工室	5,400
8	ピン立て装置	機械加工室	3,200
20	プリント配線板用UV+CO ₂ レーザ加工機	機械加工室	15,800
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室	8,100
61	衝撃試験装置	信頼性試験室	8,300
62	自動切断機	信頼性試験室	900
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室	4,100
57	プロービングシステム	電気特性評価室	3,400
R3	プロービングシステム (120GHz)	電気特性評価室	4,200
58	高周波パラメータ測定システム	電気特性評価室	11,900
59	TDRオシロスコープ	電気特性評価室	5,500
74	基板パラメータ測定システム	電気特性評価室	2,900
R2	120GHzネットワークアナライザ	電気特性評価室	33,630
R4	ダブルパルステスター	電気特性評価室	5,500
2	プリント基板真空プレス装置	プレス室	10,700
L1	レーザー顕微鏡	検査室	4,700
L2	フリップチップボンダー	クリーンルームC	11,600
L3	ワイヤーボンダー	クリーンルームC	5,700
L4	ボンドテスタ	クリーンルームC	4,000
L5	FIB	クリーンルームC	13,400

No.	機器名	設置場所	料金（税抜）
L7	ウエハープラズマクリーナー	クリーンルーム G	5,300
L8	酸化膜エッチング装置	クリーンルーム F	9,100
80	反応性イオンエッチング装置	クリーンルーム F	10,500
81	超音波探傷装置	実装エリア	8,800
82	有機溶剤現像装置	クリーンルーム G	9,000
L9	ピール試験機	検査室	3,300
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室	2,500
s1	ウェハ銅ポストめっき	クリーンルーム E	4,300
s2	SnAgめっき	クリーンルーム E	4,300
s3	電解Niめっき	クリーンルーム E	25,000
s4	Ni/Auめっき	クリーンルーム E	50,800
81	ドライフィルム剥離	クリーンルーム F	3,000
s5	チタン/Cu スパッタ	クリーンルーム F	40,600
s6	二流体洗浄装置	クリーンルーム E	5,800
s7	基板用Ni/Auめっき	水平ライン室	102,000
E43	デジタルマイクロスコープ	クリーンルーム C	1,700

三次元半導体研究センター 工賃・技術料について

●技術工賃単価

- ・ 下記の操作サポート及び受託[※]を除き、36,000円/時

※受託は原則として実施しないが、実施する場合は78,000円/時

- ・ 従来の技術料は廃止

●操作サポート工賃単価

以下の機器については、操作方法の補助のみの場合、20,000円/時とする。

No.	機器名	設置場所
7	乾燥炉200°C	クリーンルーム B
9	予熱ラミネーター	クリーンルーム B
11	クリーンローラ	クリーンルーム B
23	乾燥炉360°C	クリーンルーム B
23-2	乾燥炉	クリーンルーム E
23-3	乾燥炉Si専用	クリーンルーム D
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルーム B
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルーム C
L4	ボンドテスタ	クリーンルーム C
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルーム D
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルーム D
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルーム D
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルーム E
L7	ウェハープラズマクリーナー	クリーンルーム G
L1	レーザー顕微鏡	検査室
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室
8	ピン立て装置	機械加工室
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア
32	内蔵部品検査装置	実装エリア
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室
61	衝撃試験装置	信頼性試験室
62	自動切断機	信頼性試験室
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室